

# 特許出願非公開制度開始後の外国出願

特許庁 特許出願非公開プロジェクト事務局長 千本 潤介



令和6年5月1日から新制度がスタートします  
私の名前ですか？  
それは非公開です。

# 特許出願の非公開制度の概要（1 / 2）

（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第5章）

## 趣旨

特許出願の非公開制度を導入することにより、

- 公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、その間、必要な情報保全措置を講ずること、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止。
- これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける途を開く。

## 概要

### 1. 特許出願の非公開に関する基本指針を策定【第65条】

### 2. 技術分野等によるスクリーニング（第一次審査）【第66条】

・特許庁は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明が含まれ得る技術分野（※）に属する発明が記載されている特許出願を、内閣府に送付

※ 特定技術分野（政令で指定）：核技術、先進武器技術等の中から下記3①②の観点を踏まえて絞り込んだもの

▶ 第一次・第二次審査中及び保全指定中は、出願公開及び特許査定を留保

### 3. 保全審査（第二次審査）【第67条】

・「保全審査」（＝発明の情報を保全することが適当と認められるかの審査）における考慮要素

① 国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度

② 発明を非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影響 等

▶ 内閣府は、審査に当たり、国の機関や外部の専門家の協力を得、また、国の関係機関に協議

▶ 保全指定をする前に、出願人に対し、特許出願を維持するかの意思確認を実施

# 特許出願の非公開制度の概要 (2/2)

(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第5章)

## 概要 (続き)

### 4. 保全指定【第70条】

・「保全対象発明」を指定、出願人に通知

※ 指定の期間：1年以内。以後、1年ごとに延長の要否を判断

※ 指定の効果：

- ▶ 出願の取下げ禁止【第72条】
- ▶ 発明の実施の許可制【第73条】
- ▶ 発明内容の開示の原則禁止【第74条】
- ▶ 発明情報の適正管理義務【第75条】
- ▶ 他の事業者との発明の共有の承認制【第76条】
- ▶ 外国への出願の禁止【第78条】

### 5. 外国出願禁止（第一国出願義務）【第78条】

・日本でした2の技術分野に属する発明については、まず日本に出願しなければならないこととする第一国出願義務を規定  
(特許庁に対し、該当するかどうかを事前確認可能【第79条】) **PCT出願もここでいう「外国出願」に該当します**

### 6. 補償【第80条】

・発明の実施の不許可等により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償

## 施行期日

**令和6年5月1日**

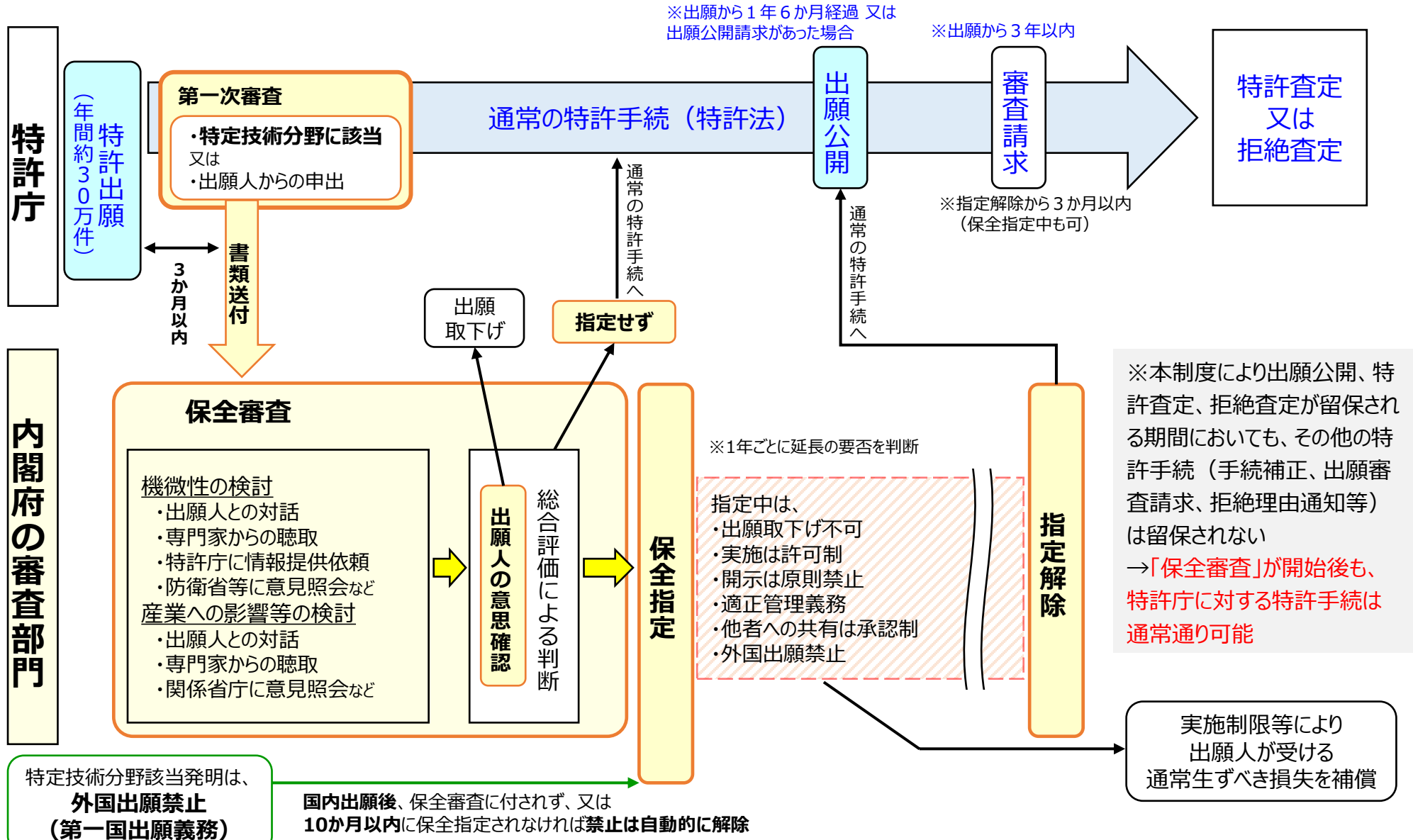


特定技術分野に該当しない発明は  
外国出願禁止されないんですか？

その通りだよ。保全審査の対象分野だけ、  
日本への第一国出願を義務付けて、保全  
指定の要否を検討する仕組みなんだ。



# 特許出願の非公開制度 手続フロー図



※禁止対象に当たるかどうかの事前確認制度あり

- **特定技術分野**：(1)～(25)の技術分野について、国際特許分類（又はこれに準じて細分化したもの）に従って規定。

## 【我が国の安全保障の在り方に多大な影響を与え得る先端技術が含まれ得る分野※】

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| (1) 航空機等の偽装・隠ぺい技術                        | (10) スクラムジェットエンジン等に関する技術            |
| (2) 武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術                | (11) 固体燃料ロケットエンジンに関する技術             |
| (3) 誘導武器等に関する技術                          | (12) 潜水船に関する技術                      |
| (4) 発射体・飛翔体の弾道に関する技術                     | (13) 無人水中航走体等に関する技術                 |
| (5) 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術                 | (14) 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの   |
| (6) 例えばレーザー兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術 | (15) 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術 |
| (7) 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術                   | (16) 宇宙航行体の観測・追跡技術                  |
| (8) 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術               | (17) 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術  |
| (9) 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの           | (18) 耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術    |
|  | (19) 通信妨害等に関する技術                    |

(10)～(19):保全指定をした場合に**産業の発達に及ぼす影響が大きい**と認められる技術分野 → **付加要件**を適用

## 【我が国の国民生活や経済活動に甚大な被害を生じさせる手段となり得る技術が含まれ得る分野※】

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (20) ウラン・プルトニウムの同位体分離技術    | (24) ガス弾用組成物に関する技術        |
| (21) 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術 | (25) ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術 |
| (22) 重水に関する技術              |                           |
| (23) 核爆発装置に関する技術           |                           |

# (参考) 政令で示す国際特許分類

項番	分野	政令第12条第1項各号	付加要件	政令で示す内容の概要
1	航空機等の偽装・隠ぺい技術	14号	-	B64及びF41H3/00が付与される技術の分野
2	武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術	15号、16号、19号、20号、30号、35号	-	B64C39/02、B64U又はG05Dが付与され、かつ、F41又はF42が付与される技術の分野
3	誘導武器等に関する技術	32号、39号	-	F41G7が付与される技術の分野 F42B15が付与される技術の分野
4	発射体・飛翔体の弾道に関する技術	37号	-	F42B10が付与される技術の分野
5	電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術	31号	-	F41B6が付与される技術の分野
6	例えばレーザー兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術	34号	-	F41H13が付与される技術の分野
7	航空機・誘導ミサイルに対する防御技術	33号	-	F41H11/02が付与される技術の分野
8	潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術	13号	-	B63G8/28からB63G8/33までのいずれかが付与される技術の分野
9	音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの	4号、7号、25号、26号、27号、28号、29号	-	B63C7/26、B63C11/48、G01S1/72からG01S1/82までのいずれか、G01S3/80からG01S3/86までのいずれか、G01S5/18からG01S5/30までのいずれか、G01S7/52からG01S7/64までのいずれか又はG01S15が付与され、かつ、F41が付与される技術の分野
10	スクラムジェットエンジン等に関する技術	23号	○	F02K7/14が付与される技術の分野
11	固体燃料ロケットエンジンに関する技術	24号	○	F02K9/08からF02K9/40までのいずれかが付与される技術の分野
12	潜水船に関する技術	2号、13号	○	B63B3/13 が付与される技術の分野 B63G8/00からB63G8/26までのいずれか又はB63G8/34、B63G8/38若しくはB63G8/39が付与される技術の分野
13	無人水中航走体等に関する技術	5号	○	B63C11/00及びG05Dが付与される技術の分野
14	音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの	3号、6号、8号、9号、10号、11号、12号	○	B63C7/26、B63C11/48、G01S1/72からG01S1/82までのいずれか、G01S3/80からG01S3/86までのいずれか、G01S5/18からG01S5/30までのいずれか、G01S7/52からG01S7/64までのいずれか又はG01S15が付与され、かつ、B63Gが付与される技術の分野
15	宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術	17号	○	B64G1/58、B64G1/62、B64G1/64又はB64G1/68が付与される技術の分野
16	宇宙航行体の観測・追跡技術	18号	○	B64G3が付与される技術の分野
17	量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術	40号、45号、46号	○	G01J1/02からG01J1/08までのいずれか、H01L27/14からH01L27/148までのいずれか又はH01L31/08からH01L31/119までのいずれかが付与される技術の分野のうち、量子ドット又は超格子に関するもの
18	耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術	41号	○	G06F21/86又はG06F21/87が付与される技術の分野
19	通信妨害等に関する技術	47号	○	H04K3が付与される技術の分野
20	ウラン・プルトニウムの同位体分離技術	1号	-	B01D59が付与される技術の分野のうち、ウラン又はプルトニウムに関するもの
21	使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術	42号	-	G21C19/33からG21C19/50までのいずれかが付与される技術の分野
22	重水に関する技術	21号	-	C01B5/02が付与される技術の分野
23	核爆発装置に関する技術	43号、44号	-	G21J1が付与される技術の分野 G21J3が付与される技術の分野
24	ガス弾用組成物に関する技術	22号	-	C06D7が付与される技術の分野
25	ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術	36号、38号	-	F42B5/145が付与される技術の分野 F42B12/46からF42B12/54までのいずれかが付与される技術の分野

付加要件の判断対象

## (参考) 特定技術分野の見直しの可能性

Q 2-11 特定技術分野は、今後、変更されることはありますか。

- 先端技術は日進月歩で変わるものであることに鑑み、関係行政機関とも連携し、状況変化に応じて、機動的に特定技術分野の見直しを行うこととしています（基本指針第2章第1節（4））。

内閣府HP「経済安全保障推進法の特許出願の非公開に関する制度のQ & A」より  
[https://www.cao.go.jp/keizai\\_anzen\\_hosho/doc/patent\\_qa.pdf](https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/patent_qa.pdf)

# 付加要件一覧

- **付加要件**：①～③のいずれかに該当する発明であること。

①防衛・軍事	我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明
②国・国研	国又は国立研究開発法人による特許出願（国又は国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く。）に係る発明
③国の委託等	<p>以下のいずれかの適用を受けた特許出願に係る発明</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>日本版バイ・ドール制度</b>（産業技術力強化法第17条） 産業技術力強化法第17条第1項第1～4号に規定する条件を受託者が約する場合に、各省庁が政府資金を供与して行っている委託研究開発（国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。）に係る知的財産権について、100%受託者（民間企業等）に帰属させうる（受託者が特許出願人となりえる）こととする制度。</li><li>● <b>科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第22条</b> 国の委託研究であって、本邦法人と外国法人等が共同して行うものの成果に係る知的財産権について、国がその一部のみを受託者から譲り受けすることができる（国と受託者の共同出願となりえる）とする制度。</li></ul>

※③の場合、**特許出願の願書に以下のような記載が必要。**

【国等の委託研究の成果に係る記載事項】

令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業（又は請負事業）、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願

（注）以降のスライドにおいて、「特定技術分野に属する発明」とは、  
付加要件の対象分野については、付加要件も満たす発明を意味するものとして説明



# 外国出願禁止の対象となるか確認したい場合

- 日本国内でした発明であって公になっていないものが、**特定技術分野に属する発明**であるときは、政令で定める例外を除き、**外国出願（※）が禁止（第78条）**

（※）外国出願には特許協力条約（PCT）に基づく国際出願も含まれる



特定技術分野に該当しなければ外国出願が禁止されないといっても、判断に迷うときは、どのようにしたらいいの？

方法	1. 日本への第一国出願 (第一次審査・保全審査)	2. 外国出願の禁止に関する事前確認
手続	特許出願 ★オンライン手続or書面手続	外国出願事前確認のための申出書の提出 ★書面手続
言語	日本語	日本語 or 英語
判断期間	出願日から3か月以内（第一次審査） 出願日から10か月以内（保全審査）など ※詳細はスライド9参照	申出書が特許庁に届いた日から10開庁日程度 ※特許庁が内閣府に確認を求めない場合、 添付書類が長大ではない場合 等
手数料	14,000円（出願料金）	25,000円
留意点	特定技術分野に属する発明でも、 保全指定されなかったものは外国出願が可能となる。	・特許庁が特定技術分野に属する発明であると判断した場合、内閣府が「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らか」と判断しない限り外国出願不可。 ・特許請求の範囲は記載不要。

# 日本へ第一国出願後、外国出願が可能となる条件

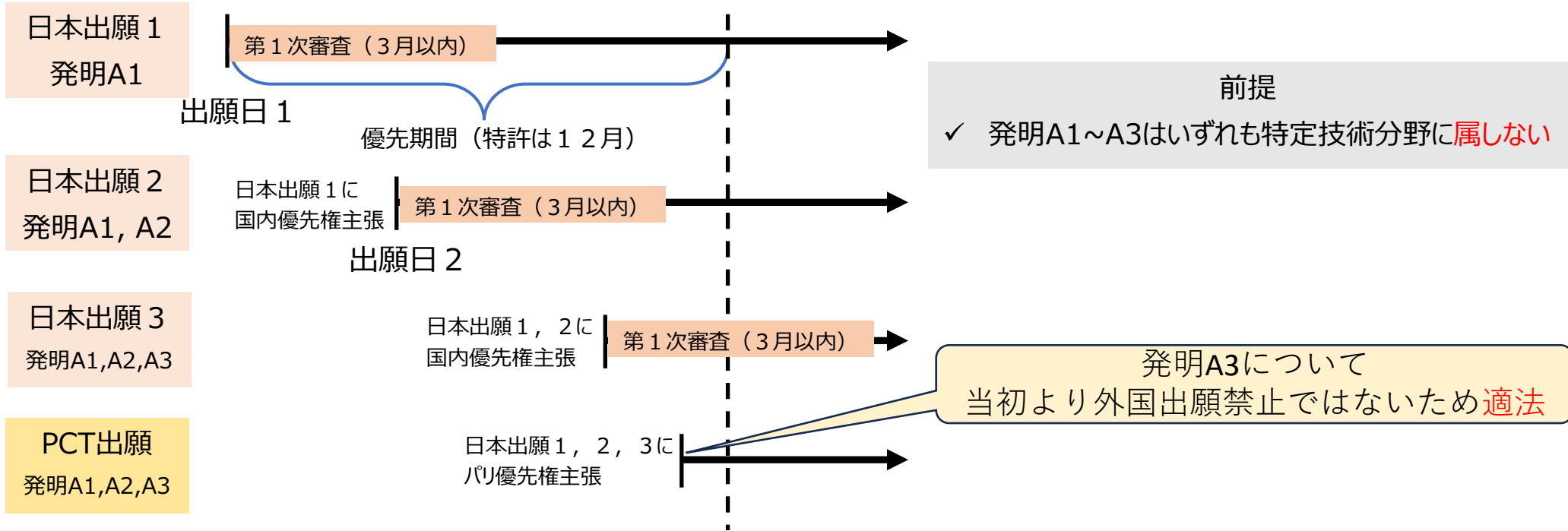
- 日本へ第一国出願後、一定の条件を満たせば、特定技術分野に属する発明であっても、外国出願が可能となる

## 外国出願が可能となる条件（以下のいずれかを満たす場合）

- ① 出願日から3か月以内に第66条第3項の通知（特許庁から内閣府へ送付した旨の通知）が発せられなかった
- ② 第66条第10項の通知（特許庁から内閣府へ送付しなかった旨の通知）がされた※②は申出がある場合のみ通知される
- ③ 出願日から10か月経過した（保全指定された場合や10か月経過前に出願の却下・放棄・取下げがあった場合を除く。）又は保全指定する必要がない旨の通知（第71条）がされた
- ④ 保全指定が解除された
- ⑤ 保全指定の期間が満了した

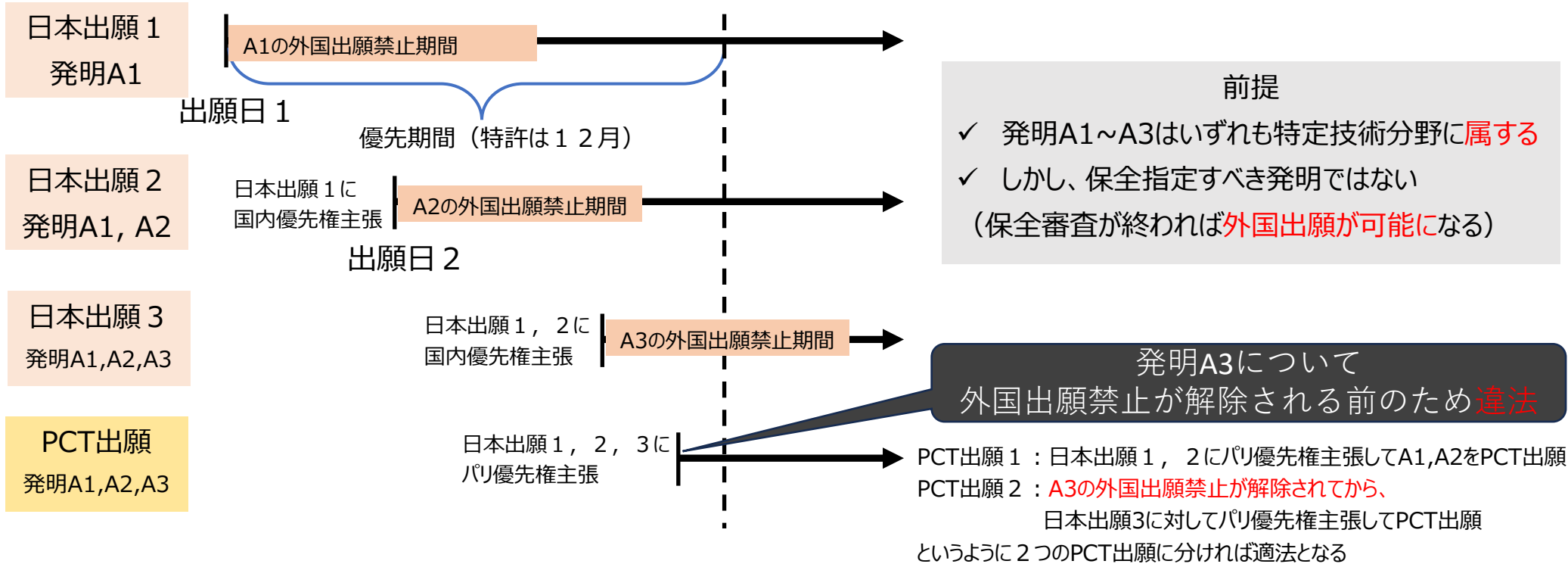
第一次審査の結果、  
保全審査に付されなかった場合

# (参考) 複数の国内出願を束ねてPCT出願をする場合 (多くのケース)



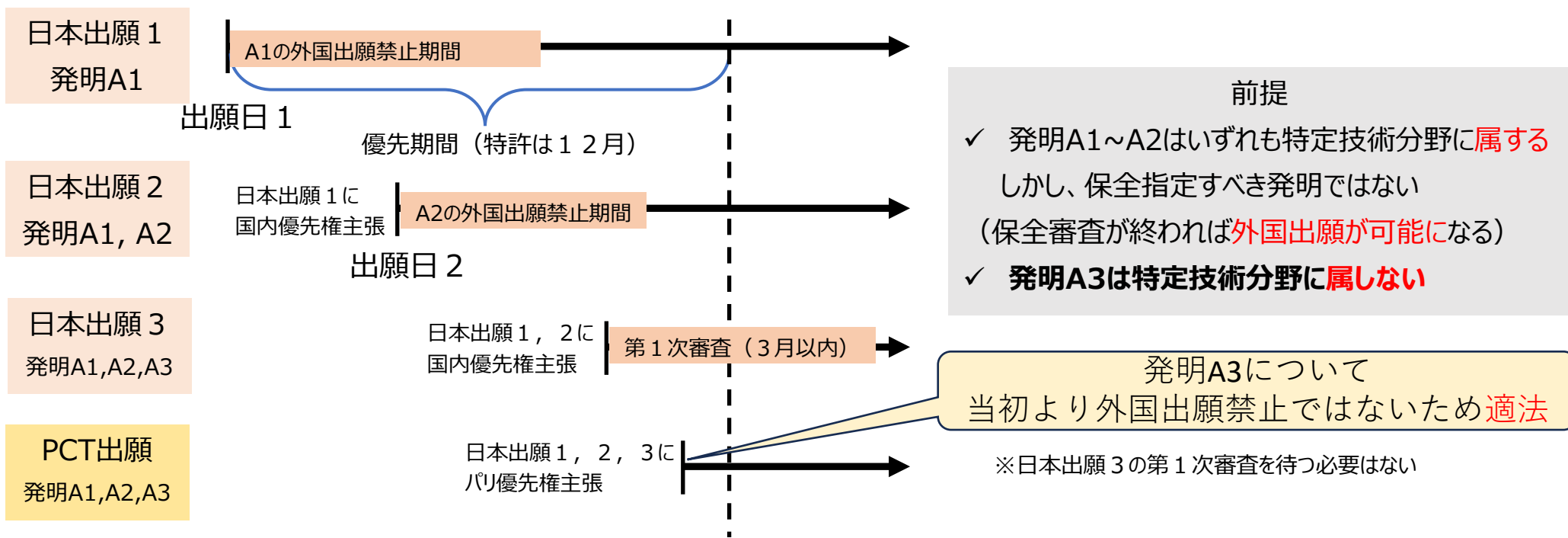
(ポイント) 特定技術分野に属しない発明であれば、  
1 次審査 (3 月以内) を待たずに PCT 出願可能  
※ただし、自信が無ければ、1 次審査を待って、内閣府へ送付されなかったことを確認してから PCT 出願する方が安全

# (参考) 複数の国内出願を束ねてPCT出願をする場合 (違法となる場合)



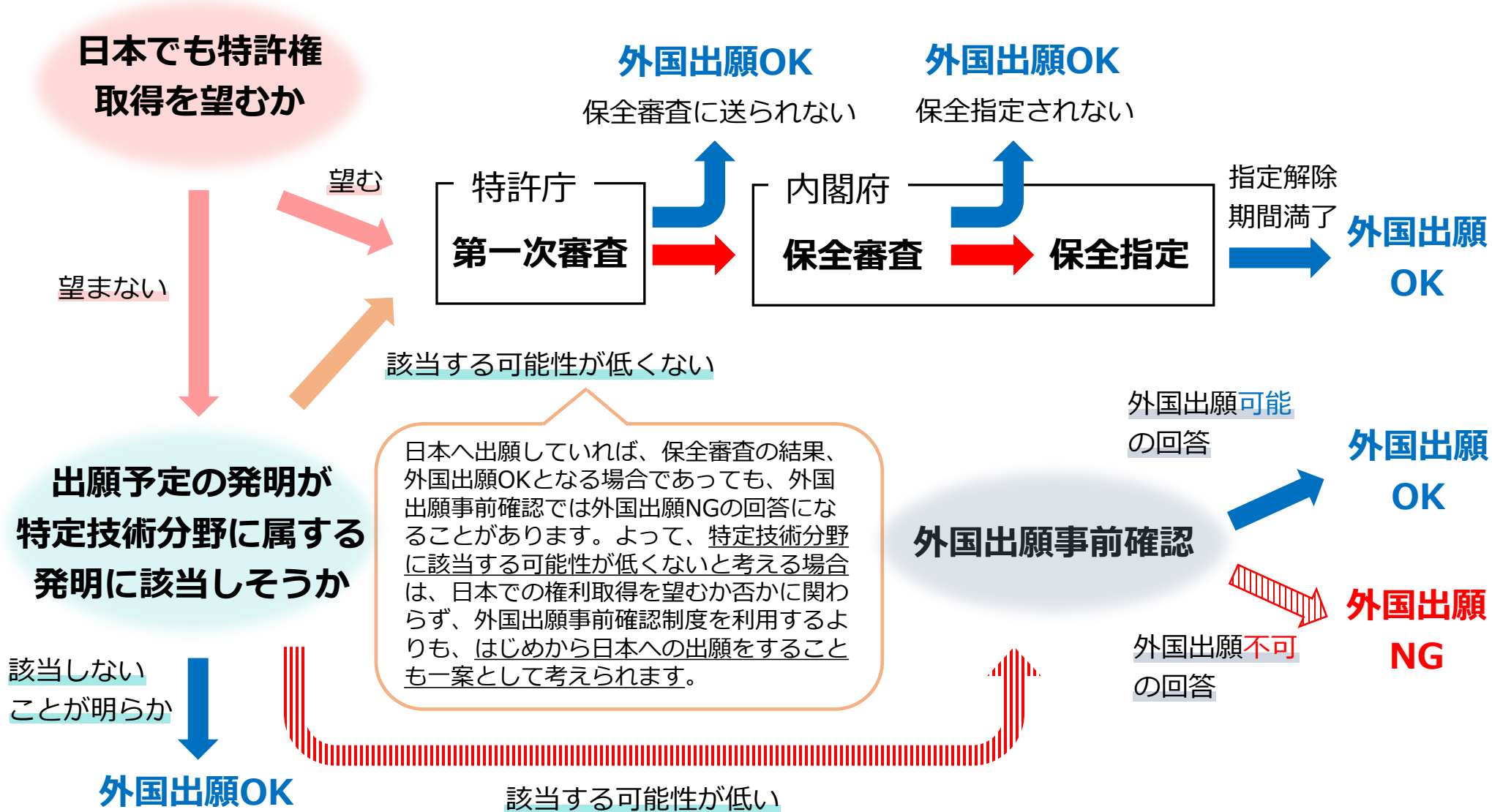
(ポイント) 外国出願禁止に該当するかは**発明単位**で考える

# (参考) 複数の国内出願を束ねてPCT出願をする場合 (応用事例)



(ポイント) 外国出願禁止に該当するかは**発明単位**で考える

# 出願人が外国出願を検討する場合の判断フロー例



## (参考) 複数国にまたがって研究・開発が行われた場合

Q 8 - 2 日本と外国にまたがって研究・開発が行われた発明は、法第 78 条第 1 項の「日本国内でした発明」に当たりますか。

- 「日本国内でした発明」とは、日本国内で完成した発明を意味します。  
したがって、複数国にまたがって研究・開発が行われた場合には、発明の完成地がどこであるかによって判断されます（基本指針第 4 章第 5 節）。
  
- なお、発明の完成について、最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決（昭和 61 年（才）第 454 号）によれば、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法二条一項）、一定の技術的課題（目的）の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるといふ効果の確認という段階を経て完成されるものであるが、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である」とされています。

内閣府HP「経済安全保障推進法の特許出願の非公開に関する制度のQ & A」より  
[https://www.cao.go.jp/keizai\\_anzen\\_hosho/doc/patent\\_qa.pdf](https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/patent_qa.pdf)

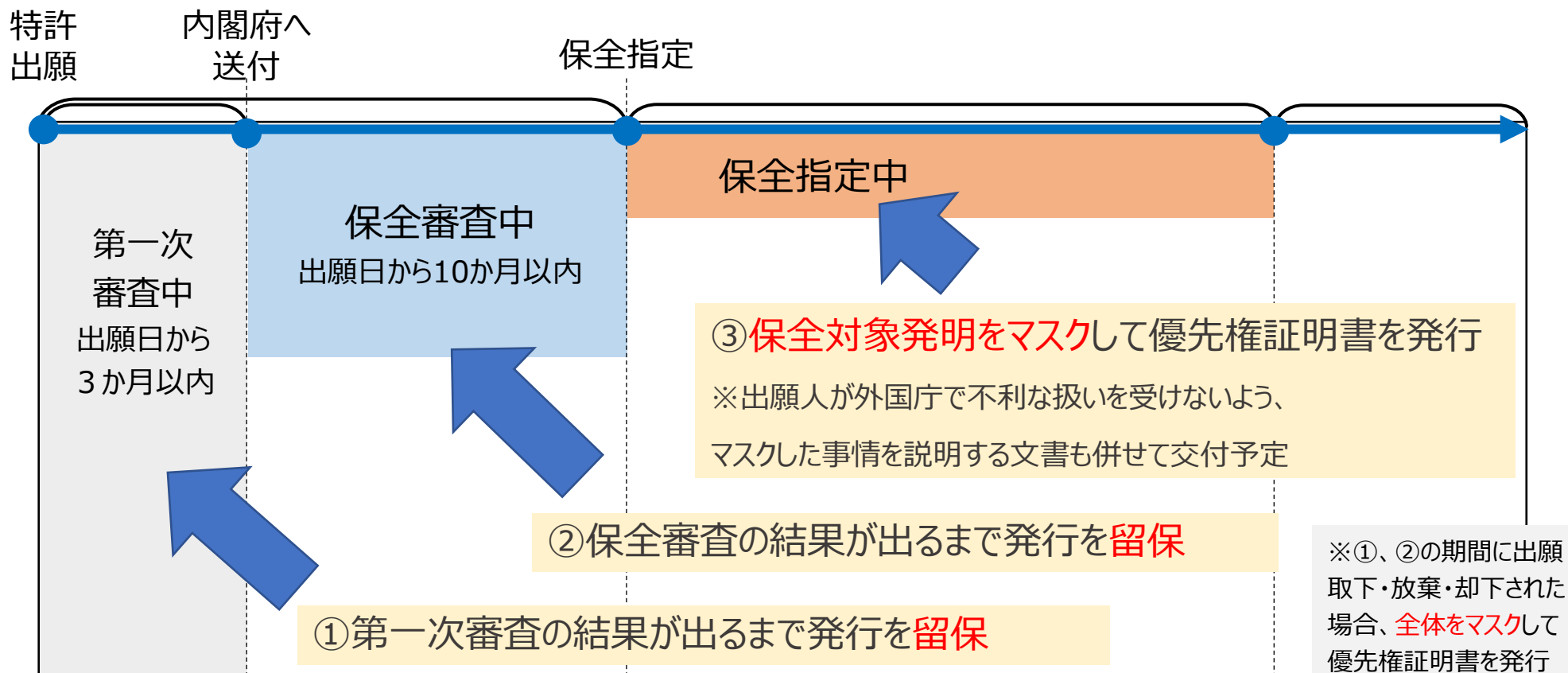
ただし、日本において外国出願禁止（第一国出願義務）が問題となるのは特定技術分野に属する発明のみ

# 優先権証明書発行に関する問題への対処



## 基本的な考え方

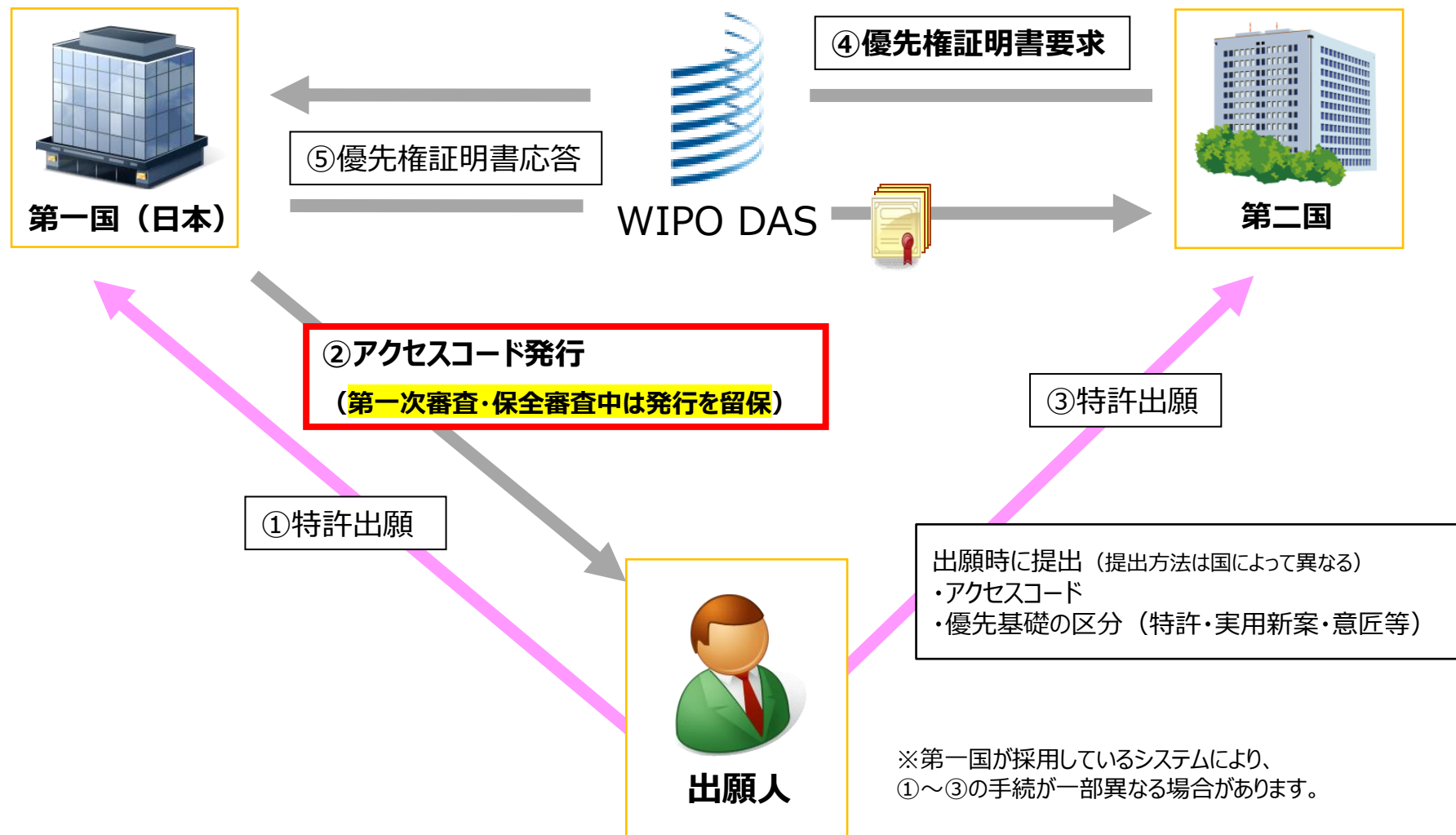
- 適法に外国出願がなされた場合、優先権証明書は発行すべき
- 一方で、優先権証明書に保全対象の発明をそのまま記載することは防ぐべき



第一次審査は全出願が対象 ⇒ **第一次審査中は一律に優先権証明書の発行を留保**  
(参考) 出願から3か月以内の発行件数は約3,000件で全出願の約1% (2021年度)



# (補足) 優先権証明書の電子的交換 (DAS) の場合



# 3/11 英語版HPをリリース！



[Home](#) > [Systems/Procedures](#) > [Patents](#) > [Filing](#) > System for Non-disclosure of Patent Applications

## System for Non-disclosure of Patent Applications

March 11, 2024  
The Japan Patent Office

On May 1, 2024, the system for non-disclosure of patent applications (hereinafter referred to as the “System”) will be introduced under the Economic Security Promotion Act (hereinafter referred to as the “Act.”) Under the System, if the description etc., of a patent application includes an invention that, if made known to the public, would be highly likely to create a situation to undermine the security of the nation and its citizens through actions taken from the outside, **the patent procedures, such as publication of the application, decision of patent grant and decision of refusal, are suspended by a procedure established as “security designation.”**

A review of whether a patent application should be kept non-disclosed (whether a security designation should be made or not) is carried out in two stages: a primary review by the JPO and a security review (a secondary review) by the Cabinet Office. In addition, after the introduction of the System, foreign applications (including international applications pursuant to the Patent Cooperation Treaty, i.e., PCT applications) are prohibited in certain cases. Therefore, the system that seeks a prior confirmation from the Commissioner of the JPO as to whether or not the foreign application is prohibited (Prior Confirmation Regarding Prohibition of Foreign Applications) is newly provided.

**In the System, this page focuses on the system of Primary Review by the JPO and the system of Prior Confirmation Regarding Prohibition of Foreign Applications. Please also see the [Q&A \(Japanese only\)](#) if necessary.** For more information on the System in general, a security review and matters after a security designation is made (e.g., permission to work a patent, measures for proper management, compensation for losses,) please see [the Cabinet Office website \(link to external site. Japanese only\)](#).

Further, [the briefing sessions on legal reform for the “Act for Partial Amendment of the Unfair Competition Prevention Act, 2023,” etc., \(Japanese only\)](#) provides information on the System. A video briefing on the System is also available on [JPePlat \(link to external site. Japanese only\)](#).

# ご清聴ありがとうございました

特許出願非公開制度については以下のページも御覧下さい

内閣府ページ 制度全般、保全審査、保全指定後（適正管理措置、損失補償等）はこちらを御覧下さい

[https://www.cao.go.jp/keizai\\_anzen\\_hosho/patent.html](https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/patent.html)

特許庁ページ 第一次審査、外国出願禁止の事前確認に関する情報はこちらを御覧下さい

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html>

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/qa.html>

IPePlatの説明動画 本日お話しした外国出願関係も含めて、詳細な説明がありますので是非御覧下さい

[https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P\\_studyview2.aspx?JoqiTZZ2DWE7GOgNW1clfvUgtDMDkRqr7SDF3mot1c0xYO2J82ELdQ%3d%3d](https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Course/P_studyview2.aspx?JoqiTZZ2DWE7GOgNW1clfvUgtDMDkRqr7SDF3mot1c0xYO2J82ELdQ%3d%3d)



最後の2スライドは「付録」よ。

今日のポイントを表裏1枚紙にまとめたから、  
外国で特許を取りたい方は手元に置いておくといいわ

# 令和6年5月1日から、特許出願の非公開制度が施行されます

内閣府・特許庁

- 本制度は、安全保障上拡散すべきでない発明の内容が含まれる特許出願が、出願公開されることを防ぐためのものです。
- そのため、**非公開の対象となり得る技術分野（特定技術分野、詳細は裏面参照）に該当しない発明の特許出願は、出願から特許の取得までの流れや出願公開に変更はありません。**
- 一方で、**外国出願の禁止の対象となる場合には注意する必要があります**ので、下のフロー図をご参照ください。

国内特許のみ  
取りたい

国内と外国の両方の特許を取りたい

外国特許のみ  
取りたい

先に国内出願

先に外国出願

＜国内出願のみ＞

ほとんどの出願において、本制度について特別な対応は必要ありません。  
必要な場合、出願日から  
**3か月以内に通知※1**します。

＜国内出願後、パリ優先権主張をして外国出願＞

全ての国内出願について、本制度による審査を行います。

審査の結果、非公開の対象外と判断されれば、制約なく外国出願できるようになります※2。


**特定技術分野に該当しない発明は、  
審査結果を待たずに、  
外国出願（PCT出願含む）  
可能です。**

＜国内出願をしていない状態で外国出願＞

（日本国内でした発明であって公になっていないもので）  
**特定技術分野に該当する発明は、  
外国出願（PCT出願含む）禁止です。**

（違反に対しては罰則※3が科せられます。）

**まずは、特定技術分野であるか確認してください※4。**

**Point**  特定技術分野に該当する発明であっても、先に国内出願し、非公開の対象外と判断されれば、外国出願禁止が解除され、外国出願できるようになります。

特定技術分野に該当する場合や、判断が付かない場合は、先に国内出願するのも一案です※4。

**特定技術分野に該当しない発明は、  
外国出願（PCT出願含む）可能です。**

優先権証明書及びアクセスコードについて

本制度により非公開の対象か否かを判断する間※2、優先権証明書・アクセスコードの発行を留保します。

※1 特許出願に特定技術分野に属する発明が記載されている場合等には、特許庁から内閣府に出願書類を送付して非公開の対象とすべきかの検討をします。この場合、送付をした旨を特許出願人に対して通知します。

※2 判断期間は、通常は3か月以内ですが、特定技術分野に該当する場合は、非公開の対象とすべきかの検討が必要なため、最長で10か月かかります。

※3 一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金、又はこれを併科。また、対応する国内出願があれば却下される場合があります。

※4 国内出願をせずに、外国出願の禁止に該当するか否かについて特許庁長官に確認を求めることができる制度（事前確認制度、手数料25,000円）も新設されます。

ただし、先に国内出願（出願手数料14,000円）をした場合、特定技術分野に該当しても、非公開の対象とすべきかの検討をした結果、対象外と判断されれば、外国出願禁止が解除され、外国出願が可能となりますが事前確認制度では、そのような検討を行う過程がないため、特定技術分野に該当するものは、非公開の対象となります。また、特定技術分野に該当するもののうち、非公開の対象とならないものを除き、外国出願が禁止される旨の回答となります。



▲詳細はこちら

**(参考) 特定技術分野の概要**

特定技術分野：(1)~(25)の技術分野について、国際特許分類（又はこれに準じて細分化したもの）に従って規定。

**【我が国の安全保障の在り方に多大な影響を与え得る先端技術が含まれ得る分野※】**

- |   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| (1) 航空機等の偽装・隠ぺい技術                       | (10) スクラムジェットエンジン等に関する技術            | <b>付加要件対象分野</b><br>付加要件を満たさないものは、非公開の対象になりません。外国出願も禁止されません。 |
| (2) 武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術               | (11) 固体燃料ロケットエンジンに関する技術             |   |
| (3) 誘導武器等に関する技術                         | (12) 潜水船に関する技術                      |   |
| (4) 発射体・飛翔体の弾道に関する技術                    | (13) 無人水中航走体等に関する技術                 |   |
| (5) 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術                | (14) 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの   |   |
| (6) 例えばレーザ兵器、電磁パルス(EMP)弾のような新たな攻撃又は防御技術 | (15) 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に関する技術 |   |
| (7) 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術                  | (16) 宇宙航行体の観測・追跡技術                  |   |
| (8) 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術              | (17) 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に関する技術  |   |
| (9) 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの          | (18) 耐タンパ性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術    |   |
|   | (19) 通信妨害等に関する技術                    |   |

**付加要件：** ①我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明 ②国又は国立研究開発法人による発明 ③国の委託等に係る発明

**【我が国の国民生活や経済活動に甚大な被害を生じさせる手段となり得る技術が含まれ得る分野※】**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (20) ウラン・プルトニウムの同位体分離技術    | (24) ガス弾用組成物に関する技術        |
| (21) 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術 | (25) ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術 |
| (22) 重水に関する技術              |                           |
| (23) 核爆発装置に関する技術           |                           |